

## 2015春季講演会(東海大)シンポジウム

### シンポジウムの主題(全体テーマ名)

日本語	リソグラフィ技術の最新動向
英語(必須)	The latest trend of the lithography technology

### 世話人

	氏名	所属	
1	藤井 清	ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング(株)	
2	須賀 治	(株)EUVL基盤開発センター	
3	岡崎信次	ギガフoton(株)	

### 企画の趣旨および内容説明

#### ・企画の趣旨

応用物理学会の学術講演会では、リソグラフィ技術に関する講演の減少傾向が続いている。これは、国内半導体メーカーの多くが最先端技術の研究開発から撤退し、学会発表を行わなくなったためであり、最近では、大学やコンソーシアムの講演が中心になっている。このような状況では、応物講演会に参加しても、実際に半導体製造に用いられている最新リソグラフィ技術や研究開発の全体像が掴みにくくなってきた。そこで、国内の半導体メーカー、製造装置メーカー、材料メーカーから最先端の研究開発に携わる方々に、EUVリソグラフィ、自己組織化(DSA)技術など、注目されるリソグラフィ技術に関する講演をお願いし、学会参加者に最新の技術動向を紹介する。

・企画母体:次世代リソグラフィ技術研究会

#### ・トピックス性・過去の実績・準備状況

リソグラフィの最新技術は、SPIEやEUVLシンポジウムなどの国際学会で発表される傾向にあり、これらが応物シンポジウムで聴講できることは、学会参加者にとってメリットが大きい。また、EUVリソグラフィやDSAは、実用化目前の非常に話題性の大きい技術である。なお、応物講演会では、2012年春に、チュートリアルとしてスクール「リソグラフィ技術の基礎」を、リソグラフィ技術研究会の企画で開催したが、最新技術動向に関するシンポジウムは、ここ数年は開催していない。シンポジウムの準備に関しては、講演者の選定等を次世代リソグラフィ研究会の運営委員会で進めているところである。

#### ・チュートリアル・一般セッションとの関連性

一般セッション「7.3 リソグラフィ技術」と参加者が重複するため、学会参加者が両方に参加できるようにプログラムを調整いただく。また、シンポジウムでは一般公演も受付、テーマ、内容によって、一般セッションとの間で振り分けたい。

・想定できる参加者のコミュニティー(分科、分野等):7.3 リソグラフィ、7.4 インプリント